



2000年6月1日

**「プレイステーション 2」向け0.18ミクロン半導体増産に向けて
総額1250億円を投資し、新たにFab2を建設、既存ラインも増強へ**

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCEI）が、本年3月4日に国内で発売を開始した「プレイステーション 2」（以下PS2）は、幅広いユーザーの皆様に支持され、発売から82日間という短期間で累計200万台を超える生産出荷を達成いたしました。併せて本年10月26日から北米、そして欧州における販売も開始し、全世界規模での家庭内エンタテインメント・プラットフォームとして、今後大幅な市場の拡大を目指しています。

併せて、次世代のインターネット網として期待が集まるブロードバンドネットワークに直接接続可能な家庭内端末として、従来のパッケージ・メディアにとどまらない新たなブロードバンド・ネットワーク・メディア時代の到来を加速するものと期待しています。これら国内の拡大する需要および海外への展開、そしてネットワーク対応に伴うPS2のさらなる増産に向けて、計画を加速し、最先端の0.18～0.15ミクロン・プロセスに対応した半導体生産ラインを、総額約1250億円を投じて増強することを決定いたしました。

これは、昨年度より実行中の総額約1300億円の半導体投資に続くもので、SCEIは大分県大分市に株式会社東芝と合弁で設立した株式会社大分ティーエスセミコンダクタ（以下OTSS）に対する追加設備投資、長崎県諫早市に設立したソニー・コンピュータエンタテインメントFab1の未実装部分（1500平方メートル）に対する追加設備投資を行い、併せて同敷地内に最先端の0.18～0.15ミクロン・プロセスに対応した新棟Fab2を建設いたします。

Fab2は2階建て、クリーンルーム面積最大20000平方メートルのSMIF対応最新鋭工場となり、この内6000平方メートルに相当する部分に新たなFab1と同様の8インチウエハ対応の設備を導入いたします。新工場の着工は2000年7月、竣工は2001年2月、稼働は2001年4月を目標に準備を進めています。

また株式会社東芝が大分工場内で建設中の最先端0.18～0.15ミクロン・プロセス対応の新棟（ANNEX）内に、OTSSがオペレーションする新規設備を導入いたします。建物の竣工は2001年1月、2001年4月からの本格稼働をめざしています。

これらにより、それぞれ月産1万枚の処理能力を、2001年6月を目処に、Fab1、Fab2合計で1万8千枚、OTSSで1万5千枚に引き上げる計画です。これらにより、128ビットCPU「エモーションエンジン」(以下EE)および混載DRAMプロセスに対応した「グラフィックス・シンセサイザ」(以下GS)の一層の増産が可能になるばかりではなく、同じく混載DRAMプロセスを採用したDVD/CD関連LSIや、サウンド・プロセッサのさらなる集積化が進み、PS2本体のコストダウンと生産能力拡大に大きく寄与するものと期待しています。

また今回の投資は、将来の大幅な成長が期待されている、家庭内のネットワークゲートウェイとなる各種デジタル機器(デジタルテレビ/セット・トップ・ボックス等)に使用される大規模プロセッサの生産供給力確保の観点からも、ソニー・グループにとって極めて戦略的な位置付けとなっています。これら将来のデジタル機器では、多層配線や混載DRAMプロセスが重要な要素技術として多用される予定です。PS2では、これらの最先端半導体技術を、大規模半導体として積極的に採用しています。これを短期間に大量に販売可能なシステムに適用し、生産を垂直に立上げて世界最効率の半導体生産工場を実現するものです。

SCEIでは、今回の成果と半導体供給能力の継続的な増強をもとに、今後PS2チップセットの外販に加え、次世代プロセッサのデジタル家電領域への展開と外販を積極的に進めて参ります。

既にソニー国分株式会社の0.25ミクロン(ゲート長0.18ミクロン)混載DRAMプロセスによる「GS」生産と、OTSSの0.25ミクロン(ゲート長0.18ミクロン)プロセスによる「EE」生産は順調に立上がり、本年夏以降は、Fab1およびOTSSの双方で昨年度投資による0.18ミクロンプロセスに全面的に移行し、秋以降のPS2の生産能力は月産140万台規模に拡大する予定です。

SCEIは、今後とも「プレイステーション」および「プレイステーション2」を中心に、ゲーム・音楽・映画・出版・番組等が融合した新しいコンピュータ・エンタテインメントの世界の創造に努めるとともに、最先端半導体の分野においても、今後とも強力なドライビングフォースであり続けたいと考えています。併せて、グローバルなブロードバンド・ネットワークの構築を強力に推進してまいります。

SMIFF・・・“Standard Machine Interface”半導体工程の局所クリーン化技術。これにより、省エネルギー化が容易となる。

以 上

概要

F a b 1

所在地：長崎県諫早市

クリーンルーム面積：9 0 0 0 m²

生産能力：月産1 2 0 0 0枚（8インチウエハ） 増強後

投資額：約2 3 0億円

F a b 2

所在地：長崎県諫早市

クリーンルーム面積：2 0 0 0 0 m²

生産能力：月産6 0 0 0枚（8インチウエハ）

投資額：約6 7 5億円

大分ティーエスセミコンダクタ

所在地：大分県大分市

生産能力：月産1 5 0 0 0枚（8インチウエハ） 増強後

投資額：約3 4 5億円

以 上